

Electronique : les limites du silicium encore repoussées

Par *admin*

Créé le 18/03/2000 - 00:00

Electronique : les limites du silicium encore repoussées

Vendredi, 17/03/2000 - 23:00 [0 commentaire](#)

- [Diminuer la police](#)
- [Augmenter la police](#)
- [Imprimer](#)
- [Version PDF](#)

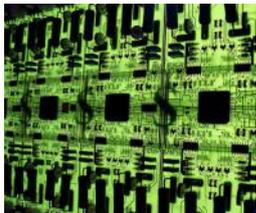
•

- [Tweeter](#)

•

•

0 avis :



[zoom](#)

Le MIT vient de réaliser des grilles de transistors de 50 nanomètres grâce à une technique qui utilise les outils industriels d'aujourd'hui.. Une première ! Le silicium a encore de beaux jours devant lui. Le laboratoire de Lincoln du MIT vient de démontrer qu'il est possible de réaliser des gravures bien en-deçà de la limite des outils de lithographie optique actuelles. Cette limite est de 248 nanomètres. Mais en utilisant un logiciel de décalage de phase sur un système de lithographie classique, il est possible de diminuer encore l'épaisseur des traits de gravure. Les Cassandre expliquaient encore récemment que la limite actuelle était de 100 nanomètres et qu'il faudrait attendre presque une décennie pour passer outre... L'avantage de cette technologie, développée par Numerical Technologies, est qu'elle permet d'utiliser les outils industriels existant, sans changer profondément le processus de fabrication des puces électroniques. A deux milliards de dollars l'unité de fabrication, on peut comprendre tout l'intérêt que peuvent lui porter les fabricants de semi-conducteurs. Ils pourront ainsi concevoir des puces beaucoup moins gourmandes en énergie et surtout plus rapides.

Usine Nouvelle : <http://www.usinenouvelle.com/>

Noter cet article :

Recommander cet article :

-
- [Tweeter](#)
-
- **Nombre de consultations :** 128
- **Publié dans :** [Electronique](#)
- **Partager :**
 - [Facebook](#)
 - [Viadeo](#)
 - [Twitter](#)
 - [Wikio](#)

[Electronique](#)

URL source: <https://www.rtflash.fr/electronique-limites-silicium-encore-repoussees/article>